

APP NANO PROCESSING SYSTEM

大気圧プラズマナノ加工装置

Model : AP-01S-200M

ap
more. AP.



特長

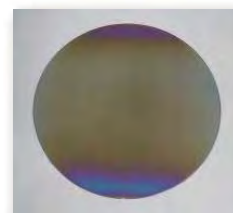
- 低温成膜 (～ 300℃)
- プラズマダメージレス
- 大気圧ゆえの高速成膜



Plasma

アプリケーション

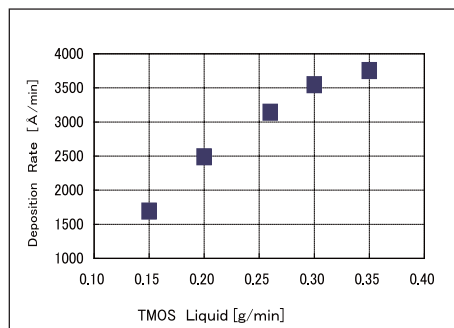
- 樹脂基材
- 中間層形成
- MEMS パッケージ
- バリヤー層形成



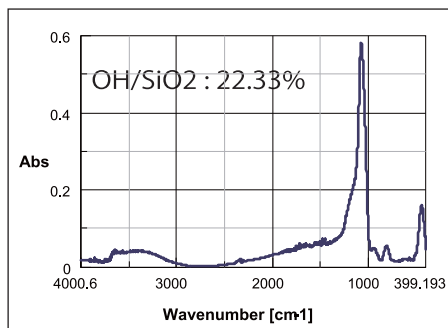
SiO2

Feature

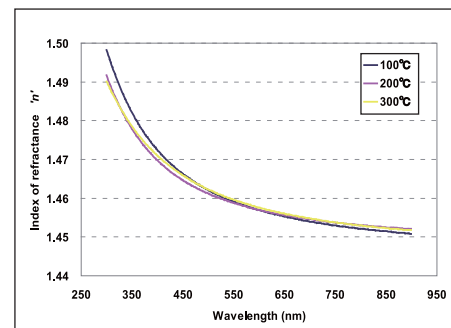
□ SiO2 (TMOS) 成膜



Flow rate

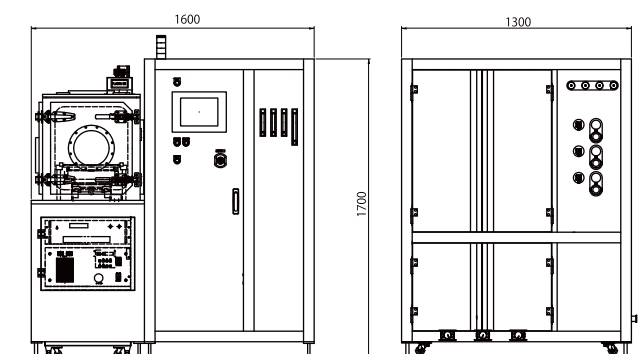


FT-IR



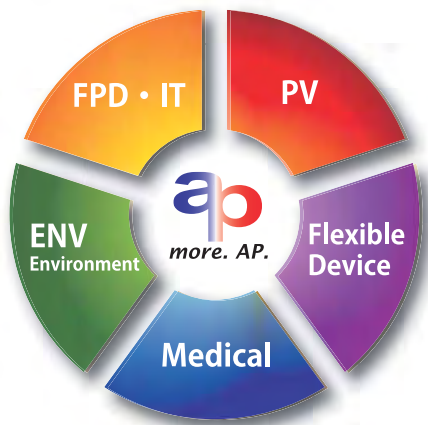
Optical contact

Specification



基材対応サイズ	□ 200 mm、φ 200 mm
対象膜	SiO ₂ (TMOS)
処理方式	枚様式
プラズマ形式	ダイレクト
基材搬送	手動 (サセブタ使用)
ステージ温調	50～300℃
装置サイズ	W1,600 × H1,700 × D1,300

SEKISUI



積水化学の大気圧プラズマ

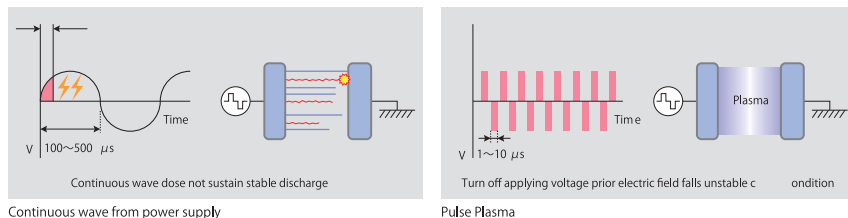


化学メーカーとしての視点と独創的な着想から生まれた「大気圧プラズマ」あらゆる分野へ新しいソリューションを提案します

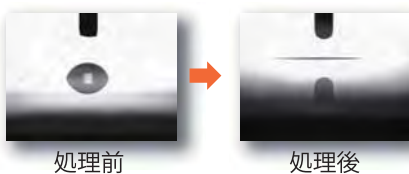
積水化学 大気圧プラズマの特長



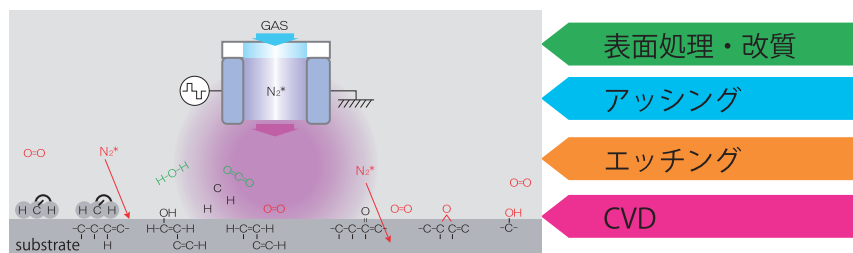
積水のプラズマは反応制御を特長とした常圧プラズマです。パルス出力でのプラズマ発生によりガス種を選ばずに反応ガスをつくりだし常圧雰囲気でも安定したプラズマを発生させることが可能です。さらにガス流を制御することで、大面積かつ均一な放電領域をつくることのできる常圧プラズマです。



大気圧プラズマによる 表面処理



プラズマ状態にした活性ガスを基材に作用させることで、極表面の有機物汚染を除去し、さらに表面に化学反応を起こし濡れ性および接着性を向上させる効果があります。



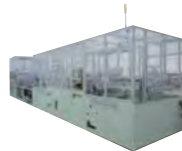
積水化学のシステムラインアップ



AP/01 大気圧プラズマ CVD 装置



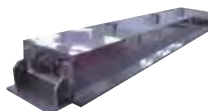
RD フィルム向け R to R 大気圧プラズマ表面処理装置



AP/E 大気圧プラズマ エッチング装置



AP/T スポットタイプ 大気圧プラズマ表面処理装置



RT インライン搭載型 大気圧プラズマ表面処理装置



AP/H スタンドアロン型 大気圧プラズマ表面処理装置



AP/D 大気圧プラズマ デスキム装置



AP/T R&D 向け 大気圧プラズマ表面処理装置

